CuInS2結晶の束縛励起子に関連した欠陥

大阪府大院 工¹、千葉工業大 工²、宮崎大 工³ 岸杭 薫¹、沈 用球¹、脇田 和樹²、吉野 賢二³

Defects properties associated with bound excitons of CuInS₂ crystals

K. Kishikui¹, Y. Shim¹, K. Wakita², K. Yoshino³

Osaka Prefecture Univ.¹, Chiba Institute of Technology², Miyazaki Univ.³

The time-resolved photoluminescence of bound excitons in bulky single crystalline $CuInS_2$ grown by the hot press method have been investigated. It is found that radiative decay of the bound exciton at 1.510 eV is well-represented by a single exponent at low temperature. In this work, the emission exhibits very fast decay so that it is dominated by the non-radiative recombination or relaxation of excitons. From the results of excitation-intensity dependence of the emission intensity, a ionized charge is to be assigned to the defect center associated with the bound exciton at 1.510 eV. We have also examined the origin of defect centers associated with the observed bound excitons.

1. はじめに

CuInS₂は太陽電池に適した 1.5 eVのバンドギャップをもち、光の吸収効率が高く、無毒 性であることから高効率薄膜太陽電池材料として期待されている。しかし、CuInS₂太陽電 池としての変換効率は 12.3%であり¹⁾、更なる変換効率向上のための一つとしてCuInS₂の 欠陥特性を十分理解する必要がある。

これまで、ヒーター移動法(THM)法およびブリッジマン(BG)法で作製したCuInS₂バルク 結晶において観測した 4 つの束縛励起子の時間分解フォトルミネッセンス(PL)特性などを 解析し、各束縛励起子の輻射寿命および欠陥の電荷状態について報告した^{2,3)}。

今回、ホットプレス(HP)法で作製したCuInS₂バルク結晶において、THMおよびBG法で 作製した結晶では見られなかった 1.510 eVにピークをもつ発光を観測した。ここでは、新 たに観測した発光について時間分解PL特性や発光強度の励起強度依存性などを調べて考察 を行った。また、これまでに観測された束縛励起子の欠陥の起源について検討した。

2. 実験方法

PL測定の試料として、HP法で作製したCuInS₂バルク単結晶を用いた。試料は 10 Kまで 冷却可能なHe循環型クライオスタットに取り付けた。励起光源としてTi:Sapphireレーザー (繰り返し周波数 82 MHz、パルス幅 100 fs)を用いた。励起光のエネルギーは 1.62 eV、励 起強度は 0.05 から 4 W/cm²である。時間分解PLスペクトルはストリークカメラ(時間分解 能 約 15 ps)を用いて観測した。

3. 結果·考察

3-1. Ex6の特性

図1にHP-CuInS2のPLスペクトルを示す。 発光スペクトルはガウス関数により、今回 観測した1.510 eVにピークを持つ発光(Ex6) と、以前の報告⁴⁾から2つの束縛励起子発光 (Ex4:1.516 eV、Ex5:1.514 eV)およびDV 発光(1.523 eV)に波形分離した。今回は最も 強度の高いEx6に注目した。

図2はEx6の発光減衰特性である。発光減 衰曲線は指数関数的であり、この減衰から 求めた発光寿命は125.5 psである。Ex6およ び以前に求めた各束縛励起しの発光寿命の 値2.3)と結合エネルギーとの関係を図3に示 す。ここで、結合エネルギーは自由励起子 と束縛励起子のエネルギー差とした。 Rashbaの報告により束縛励起子の輻射寿



図 1. PL スペクトルのガウス関数を 用いた波形分離

命は束縛エネルギーの 1.5 乗に比例することが示されている^{5,6}、図から E_{x1} , E_{x2} , E_{x3} の発 光寿命は理論直線によく一致しておりこれらの発光寿命を輻射寿命としたが、今回観測した E_{x6} の発光寿命(125.5 ps)は E_{x4} の発光寿命と同様に、この理論直線の値よりも非常に小さく なることがわかった。このことから E_{x6} の発光減衰は非輻射再結合および非輻射緩和によっ て支配されていると推測した。



図 2. 励起強度 1.9 W/cm²における E_{x6}の発光減衰曲線

図4に弱励起領域(0.05-1 mW/cm²)にお ける、Ex6のPL強度の励起強度依存性を比較 のために以前求めたEx1, Ex2, Ex4のデータ³⁾ とともに示した。Ex1, Ex2, Ex3, Ex4ではそ れぞれPL強度が励起強度の 1.5 乗に比例し ているため、これらの束縛励起子は中性欠 陥に束縛されていると推測した^{2,3)}。一方、 今回観測したEx6は、PL強度が励起強度の一 乗に比例しているため励起子はイオン化し た欠陥に束縛されていると考えられる。

3-2. 束縛励起子に関連した欠陥

これまでに観測したCuInS2の束縛励起子 に関連した欠陥の起源について検討する。 電子・フォノン結合を考慮してクーロン相互 作用から求めた各欠陥と励起子との束縛エ ネルギー⁷を表1に示す。



以前のアニール処理による研究®から、 E_{x2} はアクセプタ準位 170 - 180 meVを形成する Si⁹ に束縛され、また E_{x3} はCuInSe₂ではアクセプタ準位 170 meVを形成する V_{In} ¹⁰ または アクセプタ準位 290 meVを形成する Cu_{In} ¹⁰ に束縛されていると推論している。この推論で はそれぞれの準位は中性欠陥と仮定していたが、その後の励起強度依存性の実験から得られ た結果と矛盾は無い。また、CuInS₂では電子に対する正孔の有効質量の比は 0.12⁷ である ことからイオン化アクセプタに束縛された励起子の存在は完全に否定はできないが¹¹)、事実 上その確率は非常に低いと考えられる。よって、 E_{x6} を束縛する欠陥は束縛エネルギーが 43 meVであるイオン化ドナー(表 1) とした。この束縛エネルギーは、LewerenzとDietzが報 告¹²したVsが形成するドナー準位の値(表 2) と近い。このことから、 E_{x6} はVsのイオン化 したドナーに束縛されていると考えた。また計算から求めた各欠陥と励起子との束縛エネル ギー(表 1) と欠陥の準位(表 2) との比較から、 E_{x1} はV_{cu}の中性アクセプターに、

表 1. 束縛励起子に関連する欠陥と励起子 との束縛エネルギー

束縛励起子	ドナー準位	アクセプタ準位
	(meV)	(me V)
E _{x1}	19 (中性)	83 (中性)
E_{x2}^{n}	37 (中性)	167 (中性)
E _{x3}	56 (中性)	250 (中性)
E _{x4}	70 (中性)	317 (中性)
E	43 (イオン化)	30 (イオン化)

表 2. CuInS₂の欠陥とその準位⁹⁾

ドナー		アクセプタ		
起源	準位	起源	準位	
Vs	35 meV	V _{Cu}	80 meV	
In _{Cu}	110 meV	S _i	170 meV	
In _i	70 meV			

Ex4はIniの中性ドナーに束縛されていると推論した。以上、各束縛励起子に関連する欠陥に ついて推定した結果を表3に示す。しかし欠陥の同定を確かなものにするために、今後、ア ニール実験などにより、欠陥の起源のさらなる研究が必要である。

4. まとめ

本研究では、ホットプレス法で作製したCuInS2バルク結晶の時間分解PL測定を行った。 今回、THM、及びBG法で作製されたCuInS2バルク結晶では観測されなかった 1.510 eVで 新たなピーク(Ex6)を観測したので、Ex6について検討した。その結果、Ex6の発光寿命は 125.5 psと非常に速く、非輻射の再結合や緩和が発光減衰を支配していると考えた。また、PL強 度の励起強度依存性から、Ex6はイオン化した欠陥に束縛された束縛励起子である事が判明 した。さらに、これまでのデータから、CuInS2の束縛励起子の関連する欠陥について検討 し、その起源を推論した。

表3. 束縛励起子に関連する欠陥。

束縛励起子	欠陥
E _{x1}	V _{Cu}
E _{x2}	Si
E _{x3}	Cu _{In}
E _{x4}	In _i
E _{x6}	V _S

参考文献

1) R. Kaigawa et al., Thin Solid Films 415 (2002) 266.

2)K.Wakita et al., Appl. Phys. Lett. 85 (2004) 3083.

- 3) N. Ogushi et al., phys. Stat. sol. (c) 3 (2006) 2899.
- 4) K.Yoshino *et al.*, Appl. Phys. Lett. **78** (2001) 742.
- 5) E. I. Rashba and G. E. Gurgenishvil, Sov. Phys. Solid State 4, (1962) 759.
- 6) E. I. Rashba, Sov. Phys. Semicond. 8 (1975) 807.
- 7) J. J. M. Binsma et al., J. Lumin. 27 (1982) 55.
- 8) K. Wakita, M. Matsuo, G. Hu, M. Iwai, N. Yamamoto, Thin Solid Films **431** (2003) 184.
- 9) H. J. Lewerenz, N. Dietz, J. Appl. Phys. 73 4975 (1993).
- 10) S. B. Zhang, et al., Pys. Rev. B 57 (1998) 9642.
- 11) H. B. Bebb and E. Williams, in Semiconductor and Semimetals, (Academic, 1964) No.8 Chap.4, p.303.